MENU SEARCH INDEX DETAIL NEXT

1 / 5

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-101619

(43)Date of publication of application: 15.04.1997

(51)Int.CI.

G03F 7/028 C08F 2/44 C08F 2/50 G03F 7/004 G03F 7/027 G03F 7/033 H05K 3/06 // H05K 3/18

(21)Application number: 07-257560

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

04.10.1995

(72)Inventor: MORI TORU

MIYAO MANABU

(54) NEW PHOTOSETTING RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve sensitivity of a photosetting resin compsn. containing a 2,4,5-triarylimidazolyle-dimer.

SOLUTION: This compsn. contains 5-93wt.% vinyl copolymers having 100 to 500 acid equiv. of carboxyl groups and 20000 to 500000 weight average mol.wt., 93-5wt.% photopolymerizable monomers having at least one ethylene group on the molecular end, 0.01-20wt.% 2,4,5-triaryl imidazolyl dimer and 0.01-20wt.% p-hydroxy benzoate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-101619

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int.Cl.	# Jaco	識別記号	庁内整理番号	FI					技術表示箇所
G03F	7/028			G 0		7/028			
C08F	2/44	MCS		C 0	8 F	2/44		MCS	
-	2/50	MDN				2/50		MDN	
GOSF	7/004	503	•	G 0	3 F	7/004		503	
		5 1 2						512	
			審查請求	未請求	火龍	項の数 1	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出廢番号		特願平7-257560		(71)	人類出	000000	033		
						旭化成	工業株	式会社	
(22)出顧日		平成7年(1995)10月	大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号						
				(72)	発明者	森徹			
						静岡県 株式会		鮫島2番地の	1 旭化成工業
				(72)	発明者				
				()	,		-	波島2番地の	1 旭化成工業
						株式会		W (2) 18 19 19 19	
				.					
				1					

(54) 【発明の名称】 新規な光硬化性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 2.4.5-トリアリールイミダゾリル二量体を含む光硬化性樹脂組成物の感度の向上を図る。

【解決手段】 (イ)カルボキシル基含有量が酸当量で100~600、重量平均分子量が2万~50万のビニル共重合体5~93重量%、(ロ)少なくとも一つの末端エチレン基を持つ光重合性モノマー93~5重量%、

(ハ) 2, 4,5-トリアリールイミダゾリル二量体 0.01~20重量%、および(二)p-ヒドロキシ安 息香酸エステル0.01~20重量%を含むことを特徴 とする。 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 (イ)カルボキシル基含有量が酸当量で 100~600、重量平均分子量が2万~50万のビニ ル共重合体5~93重量%、(ロ)少なくとも一つの末 端エチレン基を持つ光重合性モノマー93~5重量%、 (ハ) 2, 4, 5-トリアリールイミダゾリル二量体 0. 01~20重量%、および(二)p~ヒドロキシ安 息香酸エステル0.01~20重量%を含むことを特徴 とする光硬化性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は光硬化性樹脂組成物 に関する。さらに詳しくはプリント配線板の製造に適し たレジスト材料として好適な光硬化性樹脂組成物に関す

[0002]

【従来の技術】従来、プリント配線板作製用のレジスト として支持体と光硬化性樹脂層からなる、いわゆるドラ イフィルムレジスト (以下DFRと略記する) が用いら れている。DFRは、一般に支持体上に光硬化性樹脂組 20 成物を積層し、多くの場合、さらに該組成物上に保護用 のフィルムを積層することにより調製される。

【0003】DFRを用いてプリント配線板を作製する ためには、まず保護フィルムを剥離した後、銅張り積層 板等の永久回路作製用基板上に、DFRを積層する。次 に必要により支持体を剥離し、配線パターンマスクフィ 支持体を剥離し、現像液により未露光部分の光硬化性樹 脂層を溶解、もしくは分散除去し、基板上に硬化レジス ト画像を形成せしめる。現像後回路を形成させるプロセ 30 スとしては、大きく二つの方法に分かれる。第一の方法 は、硬化レジストによって覆われていない銅面をエッチ ング除去した後レジストをさらに除去するものであり、 テンティング法と呼ばれる。第二の方法は、同上の銅面 に銅および半田等のめっき処理を行った後、レジストの 除去、さらに現れた銅面をエッチングするものであり、 めっき法と呼ばれる。

【0004】上記プリント配線板の製造に於いて、テン ティング法では基板の貫通孔の両側を硬化レジストで覆 うため、硬化膜の強度が高いDFRが要求された。ま た、めっき法ではめっき工程でのもぐりが無いことが重 要であった。これらの要求を満たすため、特開平3-6 202号では、2、4、5-トリアリールイミダゾリル = 二量体とローアミノフェニルケトンを有する光硬化性樹 脂組成物が有用であることが開示されている。確かに上 記技術を用いると硬化膜強度が高く、めっきもぐりが無 いためプリント配線板の製造に有用であるが、他の光重 合開始剤を用いた光硬化性樹脂組成物に比べ感度が高く

性の向上が重要視されている。このためDFRとしては 従来よりさらに感度が高く、露光時間が短縮化できるも のが求められている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、テンティン グ用あるいはめっき用DFRとして有用な2.4.5-トリアリールイミダゾリル二量体を含む光硬化性樹脂組 成物の感度の向上をその課題とする。

[0007]

10 【課題を解決するための手段】上記の課題を解決すべく 鋭意検討を重ねた結果、本発明者らは、2,4,5-ト リアリールイミダゾリル二量体を開始剤として含む光硬 化性樹脂組成物にpーヒドロキシ安息香酸エステルを加 えるとDFRとしての感度が高くなることを見出し、本 発明に完成するに至った。

【0008】すなわち、本発明によれば、(イ)カルボ キシル基含有量が酸当量で100~600、重量平均分 子量が2万~50万のビニル共重合体5~93重量%、

(ロ) 少なくとも一つの末端エチレン基を持つ光重合性 モノマー93~5重量%、(ハ)2,4,5-トリアリ ールイミダゾリル二量体0.01~20重量%、および (二) p-ヒドロキシ安息香酸エステル0.01~20 重量%を含むことを特徴とする光硬化性樹脂組成物が提

【0009】本発明の光硬化性樹脂組成物は2,4,5 ートリアリールイミダゾリル二量体を含む光硬化性樹脂 組成物の特徴である高いテンティング硬化膜強度を示 し、また、めっき工程でのもぐりとめっき液汚染性が無 いことに加えて、感度が高かった。このため露光時間の 短縮も可能となった。本発明に用いる光硬化性樹脂組成 物は、ビニル共重合体(バインダー)、光重合性モノマ 一、光重合開始剤およびp-ヒドロキシ安息香酸エステ ルを必須成分とするが、必要により染料、発色剤、可塑 剤、ラジカル重合禁止剤等を含めることができる。

【0010】本発明の(イ)成分のビニル共重合体は、 下記の2種類の単量体の中より各々1種またはそれ以上 の単量体を用い、酸当量が100~600になるように 共重合させることにより得られる。第1の単量体は分子 中に炭素 - 炭素二重結合等の重合性不飽和基を1個有す るカルボン酸であり、例えば、(メタ)アクリル酸、フ マル酸、ケイ皮酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン 酸半エステル等が挙げられる。

【0011】第2の単量体は分子中に炭素-炭素二重結 合等の重合性不飽和基を有する非酸性単量体であり、光 硬化性樹脂層の現像性、エッチング工程での耐性、硬化 膜の可とう性等の種々の特性を保持するように選ばれ る。そのような単量体としては、例えば、(メタ)アク リル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、(メタ) ア クリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸プチル、(メ 【0005】近年、プリント配線板製造においては生産 50 タ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸

2-ヒドロキシエチル等の(メタ)アクリル酸アルキル 類、(メタ)アクリル酸ベンジル、酢酸ビニル等のビニ ルアルコールのエステル類、スチレンまたは重合可能な スチレン誘導体およびアクリロニトリル等が挙げられ

【0012】ビニル共重合体の酸当量が100未満であ ると、重合体の溶解性が低下し、均一な光硬化性樹脂組 成物が得られない。ビニル共重合体の酸当量が600を 越えると、アルカリ性現像液に対する分散性が低下し、 現像できなくなる。ビニル共重合体の重量平均分子量 は、2万~50万の範囲であり、好ましくは4万~20 万である。重量平均分子量は、ゲル バーミエーション クロマトグラフィー (GPC) により標準ポリスチレ ンの検量線を用いて測定することができる。重量平均分 子量が2万未満の共重合体であると、硬化膜の強度が小 さくなりテンティング法に使用できない。この共重合体 の重量平均分子量が50万を越えると、光硬化性樹脂組 成物の粘度が高くなりすぎ、基板への密着性が低下す

【0013】また、光硬化性樹脂層に含有されるビニル 20 については一般式(1)で表される。 共重合体の量は5~93重量%の範囲であり、好ましく は30~70重量%である。ビニル共重合体の量が5重 量%未満であると、アルカリ現像液に対する分散性が低 下し、現像時間が著しく長くなる。ビニル共重合体の量 が93重量%を越えると、光硬化性樹脂層の光硬化が不 十分となり、レジストとしての耐性が低下する。

【0014】本発明の(ロ)成分である少なくとも一つ の末端エチレン性を持つ光重合性モノマーとしては、例 えば、2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピルアクリ レート、フェノキシテトラエチレングリコールアクリレ 30 ート、β-ヒトロキシプロピル-β'-(アクロイルオ キシ)プロビルフタレート、1,4-テトラメチレング リコールジ (メタ) アクリレート、1,6-ヘキサンジ オールジ (メタ) アクリレート、1, 4-シクロヘキサ ンジオールジ(メタ)アクリレート、オクタプロピレン グリコールジ(メタ)アクリレート、グリセロール(メ タ) アクリレート、2 -ジ(p-ヒドロキシフェニル) プロパンジ (メタ) アクリレート、グリセロールトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロバントリ ールプロパントリ(メタ)アクリレート、ポリオキシエ チルトリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレー ト、ジベンタエリスリトールベンタ (メタ) アクリレー ト、ジベンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレー ト、トリメチロールプロバントリグリシジルエーテルト リ(メタ)アクリレート、ピスフェノールAジグリシジ ルエーテルジ (メタ) アクリレート、ジアリルフタレー ト、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、 ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ビ

リプロピレングリコール、4-ノルマルオクチルフェノ キシベンタプロピレングリコールアクリレート等が挙げ られる.

【0015】また、光重合性モノマーとして、ヘキサメ チレンジイソシアナート、トリレンジイソシアナートな どの多価イソシアナート化合物と、2-ヒドロキシプロ ビル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシアクリレー ト化合物とのウレタン化反応物などの例をあげることが できる。本発明の光硬化性樹脂組成物中に含有される光 10 重合性モノマーの量は5~93重量%の範囲であり、好 ましくは20~70重量%である。5重量%より少ない と、光による硬化が起とらない。93重量%より多い と、光硬化性樹脂組成物が柔らかくなりすぎDFR端面 からのしみだしが激しくDFRとしての形状が保たれな

【0016】本発明の光硬化性樹脂組成物に含まれる光 重合開始剤としては、(ハ)成分である少なくとも1種 の2、4、5-トリアリールイミダゾリル二量体を必須 とする。2、4、5-トリアリールイミダゾリル二量体

[0017]

[化1]

【0018】一般式(1)の2、4、5-トリアリール イミダゾリル二量体において、2個のロフィン基を結合 する共有結合としては、1・1′-、1・2′-、1・ 4'-、2・2'-、2・4'-または4・4'-位が あるが、本発明の2、4、5-トリアリールイミダゾリ ル二量体としては、1・2'-化合物が好ましい。ま (メタ) アクリレート、ポリオキシプロビルトリメチロ 40 た、化合物中のフェニル基が置換されていてもよく、例 **えば2-(o-クロロフェニル)-4・5-ジフェニル** イミダゾリル二量体、2- (o-クロロフェニル)-4. ・5 - ビスー (m-メトキシフェニル) イミダゾリルニ **量体、2-(p-メトキシフェニル)-4・5-ジフェ** ニルイミダゾリル二量体等が用いられる。

【0019】2、4、5ートリアリールイミダゾリルニ 量体の添加量は0.01~20重量%が好ましく、さら に好ましくは、この添加量が1~10重量%である。 0.01重量%より少ないと、感度が低く実用的な感度 ス(ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート)ボ 50 が得られない。20重量%より多いと、紫外線透過率が 小さくなりすぎ、レジスト底部での硬化性が弱まり密着 性が低下する。

【0020】また、本発明の光硬化性樹脂組成物には他 の光重合開始剤を用いることができる。このような光重 合開始剤としては、特に制限はなく、光重合開始剤とし て知られている公知の化合物を用いるととができ、具体 例としては、ベンジルジメチルケタール、ベンジルジェ チルケタール、ベンジルジプロピルケタール、ベンジル ジフェニルケタール、ベンゾインメチルエーテル、ベン ゾインエチルエーテル、ベンゾインピロピルエーテル、 ベンゾインフェニルエーテル、ベンゾフェノン、p-ア ミノベンゾフェノン、p-プチルアミノフェノン、p-ジメチルアミノアセトフェノン、p-ジメチルアミノベ ンゾフェノン、p, p'ービス (エチルアミノ) ベンゾ フェノン、p, p'ーピス (ジメチルアミノ) ベンソフ ェノン [ミヒラーズケトン]、p, p'ービス(ジエチ ルアミノ) ベンゾフェノン、p, p'-ビス (ジブチル アミノ) ベンゾフェノン、9-フェニルアクリジン等の アクリジン類、α、α-ジメトキシ-α-モルホリノー メチルチオフェニルアセトフェノン、2,4,6-トリ 20 メチルベンゾイルホスフォンオキシド、フェニルグリシ ン、チオキサントン、2、4-ジメチルチオキサント ン、2、4-ジエチルチオキサントン、2-イソプロビ ルチオキサントン、4-イソプロビルチオキサントン、 2, 4ージイソプロピルチオキサントン、2-フルオロ チオキサントン、4-フルオロチオキサントン、2-ク ロロチオキサントン、4-クロロチオキサントン、1-クロロー4-プロポキシチオキサントン、さらに1-フ ェニル-1、2-プロパンジオン-2-o-ベンゾイル オキシム、2、3ージオキソー3ーフェニルプロピオン 酸エチルー2-(0-ベンゾイルカルボニル)-オキシ ム等のオキシムエステル類がある。また、p-ジメチル 安息香酸、pージエチル安息香酸及びpージイソプロビ ル安息香酸及びこれらのエステル化物を使用することが できる。アルコール部位としては、メチル、エチル、ブ ロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、Sec-プチル、tert-ブチル、n-アミル、イソアミル、 ヘキシル、オクチル等を挙げることができる。

【0021】光硬化性樹脂組成物に含まれる(二)成分のp-ヒドロキシ安息香酸エステルの量は0.01~2 400重量%であり、好ましくは0.1~10重量%である。この添加量が0.01重量%より少ないと感度向上の効果は得られない。またこの添加量が20重量%より多いと硬化膜の強度が低下する。このようなp-ヒドロキシ安息香酸エステルの具体例としては、エステルのアルコール部位として、メチル、エチル、プロビル、イソフロビル、ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘプチル、イソアミル、オクチル等が挙げられる。

[0022]本発明の光硬化性樹脂組成物の熱安定性、

保存安定性を向上させるために、光硬化性樹脂組成物に ラジカル重合禁止剤を含有させることは好ましいことで ある。そのようなラジカル重合禁止剤としては、例えば、pーメトキシフェノール、ハイドロキノン、ピロガロール、ナフチルアミン、tertーブチルカテコール、塩化第一銅、2、6ージーtertーブチルーpークレゾール、2、2、ーメチレンビス(4ーエチルー6ーtertーブチルフェノール)、2、2、ーメチレンビス(4ーメチルー6ーtertーブチルフェノール)等がある。

【0023】本発明の光硬化性樹脂組成物には染料、顔料等の着色物質を含有させるともできる。とのような着色物質としては、例えばフクシン、フタロシアニングリーン、オーラミン塩基、カルコキシドグリーンS、ハラマジエンタ、クリスタルバイオレット、メチルオレンジ、ナイルブルー2B、ビクトリアブルー、マラカイトグリーン、ベイシックブルー20、ダイヤモンドグリーン等が挙げられる。

【0024】また、本発明の光硬化性樹脂組成物には光 照射により発色する発色系染料を含有させても良い。発 色系染料としては、ロイコ染料とハロゲン化合物の組み 合わせが良く知られている。ロイコ染料としては、例え ばトリス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) メタン [ロイコクリスタルバイオレット]、トリス(4 -ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) メタン [ロイ コマラカイトグリーン] 等が挙げられる。一方ハロゲン 化合物としては臭化アミル、臭化イソアミル、臭化イソ ブチレン、臭化エチレン、臭化ジフェニルメチル、臭化 ベンザル、臭化メチレン、トリプロモメチルフェニルス ルホン、四臭化炭素、トリス(2,3-ジブロモプロビ 30・ル) ホスフェート、トリクロロアセトアミド、ヨウ化ア ミル、ヨウ化イソブチル、1.1,1-トリクロロー 2, 2-ビス (p-クロロフェニル) エタン、ヘキサク ロロエタン等がある。

【0025】さらに光硬化性樹脂組成物には、必要に応じて可塑剤等の添加剤を含有させても良い。そのような添加剤としては、例えば、ジェチルフタレート等のフタル酸エステル類、0ートルエンスルホン酸アミド、pートルエンスルホン酸アミド、クエン酸トリブチル、クエン酸トリエチル、アセチルクエン酸トリーnープロビル、アセチルクエン酸トリーnープチル、ポリプロビレングリコール等が例示できる。

【0026】光硬化性樹脂積層体の支持層としては、活性光を透過する透明なものが望ましい。そのような支持層としては、例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ボリ塩化ビニルフィルム、塩化ビニル共重合体フィルム、ボリ塩化ビニリデンフィルム、塩化ビニリデン共重合体フィルム、ボリメタクリル酸メチル共重合体フィルム、ボリスチレン共

重合体フィルム、ポリアミドフィルム、セルロース誘導 体フィルム等が挙げられる。これらのフィルムとしては 必要に応じ延伸されたものも使用可能である。

【0027】支持層と積層した光硬化性樹脂層の他、必 要に応じて光硬化性樹脂層表面に保護層を積層すること もできる。支持層よりも保護層の方が、光硬化性樹脂層 との密着力が充分小さく容易に剥離できることがこの保 護層の重要な特性である。とのような保護層としては、 例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィル <u>ム等が挙げられる。また、特開昭59-202457号 10</u> に示された剥離性の優れたフィルムを用いることもでき

【0028】露光は、超高圧水銀灯などの紫外線を用い て透明な高透過性マスクを通し、配線として残したい部 分および導電性貫通孔の開口部の被覆として残したい部 分に行われる。現像は、アルカリ水溶液を用いて未露光 部を除去するととにより行われる。このようなアルカリ 水溶液としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム等の水溶液が用いられ る。最も一般的に用いられるアルカリ水溶液は0.5~ 20 る。 3%の炭酸ナトリウム水溶液である。

【0029】エッチングは酸性エッチング、アルカリエ ッチングなど、使用するDFRに適した方法で行うこと* * ができる。エッチング後の光硬化レジストの剝離は、現 像で用いたアルカリ水溶液よりもさらに強いアルカリ性 の水溶液により剥離される。例えば、このようなアルカ リ水溶液としては1~5%の水酸化ナトリウムまたは水 酸化カリウムの水溶液を用いる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明をさら に詳しく説明する。以下の実施例中の「部」はすべて 「重量部」である。

(テンティング性の測定法)実施例中のテンティング性 は、次の方法により測定した。

【0031】支持体および光硬化性樹脂層からなる光硬 化性樹脂積層体をスルーホール径6mmφの基板にラミ ネートし、60mJ/cm²で露光した後、テンティン グ膜にシワが発生するまで現像(1%炭酸ナトリウム水 溶液、30℃、60秒)を繰り返す。シワが発生しない 限界の現像数(回)で判断し、回数が多いほど、テンテ ィング性が良好と判断する。これまでの実績から3回以 上の場合は、非常に良好なテンティング性と判断でき

[0032]

[実施例1]次の組成を有する溶液を調製した。

メタクリル酸メチル/メタクリル酸/メタクリル酸ベンシル (重量比が50/25/ 25)の組成を有し重量平均分子量が7.7万の共重合体の43%メチルエチルケ

トン溶液 (B-1) 6 7部

ノナエチレングリコールジアクリレート (M-1) ビス(ベンタエチレングリコールメタクリレート)ノナプロピレングリコール

(M-2)

無水フタル酸と2-ヒドロキシプロピルアクリレートとの半エステル化物とプ ロビレンオキシドとの反応物(M-3:日本触媒化学社製OE-A200)

2. 1部

2-(0-クロロフェニル)-4・5-ジフェニルイミダゾリル二量体(I-

1) 1.5部

ミヒラーズケトン(1-2) 0.06部

p-ヒドロキシ安息香酸メチル(I-3) 2部

マラカイトグリーン(D-1) 0.02部

ロイコクリスタルバイオレット(D-2) 0.2部

トリプロモフェニルスルホン (D-3) 0.25部

メチルエチルケトン (MEK) 16.2部

上記組成よりなる溶液を厚さ25 μmのポリエチレンテ レフタレートフィルムにバーコーターを用いて均一に途 布し、90°Cの乾燥機中に5分間乾燥して、光硬化性樹 脂層を形成した。光硬化性樹脂層の厚さは40μmであ

【0033】光硬化性樹脂層のポリエチレンテレフタレ ートフィルムを積層していない表面上に30μmのポリ エチレンフィルムを張り合わせて光硬化性樹脂糟層体を 得た。との光硬化性樹脂積層体のポリエチレンフィルム を剥がしながら、光硬化性樹脂層を銅張り積層板にホッ 50 に30°Cの1%炭酸ナトリウム水溶液を60秒間スプレ

トロールラミネーター (旭化成工業製「AL-70」) により105℃でラミネートした。エア圧力は3.5k g/cm¹ゲージとし、ラミネート速度は1.5m/m inとした。

【0034】光硬化性樹脂層に、27段ステップタブレ ット(旭化成工業製)を通して、超高圧水銀ランプ(オ ーク製作所製HMW-201KB) により60mJ/cm *で簬光した。続いて光硬化性樹脂層からポリエチレン テレフタレートフィルムを剥離した後、光硬化性樹脂層

ーし、未露光部分を溶解除去した。

【0035】現像後、光硬化性樹脂積層体の感度を見た ところ、18段だった。

[0036]

【実施例2-4および比較例1-3】実施例1と同様に して、表1に示す組成により実施した結果を同じく表1 に示す。なお、表1に示す組成の略号は、実施例1と以 下に示すものである。

B-2:メタクリル酸メチル/メタクリル酸/アクリル 酸n-ブチル (重量比が65/27/8) の組成を有し重量平 10 I-5:2、4-ジエチルチオキサントン 均分子量が12万である共重合体の29%メチルエチル

B-3: メタクリル酸メチル/メタクリル酸/スチレン (重量比が62/23/15) の組成を有し重量平均分子量が8 万である共重合体の35%メチルエチルケトン溶液 * * M-4: ヘキサメチレンジイソシアネートとオリゴプロ ピレングリコールモノメタクリレートとのウレタン反応

10

M-5: ビス(トリエチレングリコールメタクリレー ト) ノナプロビレングリコール

M-6:テトラプロピレングリコールジアクリレート M-7:4-ノルマルオクチルフェノキシベンタプロビ レングリコールアクリレート

I-4:p-ヒドロキシ安息香酸エチル I-6:p-ジメチルアミノ安息香酸エチル I-7:p-ヒドロキシ安息香酸ブチル [0037]

	实施例1	比较例1	実施例2	比較例2	实施例3	比较例3	実施例4	比较的4
	B-1 (67)	B-1(67)	B-1(67)	B-1(67)	B-2(89.7)	8-2(89.7)	8-3(74.3)	B-3(74.3)
	M-1 (4.2)	M-1(4.2)	M-1(4.2)	M-1(4.2)	M-4(10)	M-4(20)	M-1(5)	M-1(5)
	M-2(11.2)	M-2(11.2)	M-2(11.2)	M-2(11.2)	M-5(5)	M-5(10)	M-2(12)	M-2(12)
粗虹	M-3(2.1)	M-3(2.1)	M-3(2.1)	M-3(2.1)	M-6(S)	M-6(10)	M-7(3)	M-7(3)
	I-1 (0.8)	F1 (0.08)	F1(1.5)	F1(1.5)	F1(2)	F1(2)	F1(1)	F1(1)
()内は質量部	F3(2)		1-2(0.06)	1-2(0.06)	F2(0.1)	F2(0.1)	F5(0.25)	1-5(0.25)
			⊬3(2)		⊢ 4(2)		1-6(2)	⊦6(2)
							F7(2)	
	D-1(0.02)	D-1(0.02)	D-1(0.02)	D-1(0.02)	D-1(0.02)	D-1(0.02)	D-1 (0.02)	D-1 (0.02)
	D-2(0.2)	D-2(0.2)	D-2(0.2)	D-2(0.2)	D-2(0.2)	D-2(0.2)	D-2(0.2)	D-2(0.2)
	D-3(0.2)	D-3(0.2)	D-3(0.2)	D-3(0.2)	D-3(0.2)	D-3(0.2)	D-3(0.2)	D-3(0.2)
	MEK(16.2)	MEK(16.2)	MEK(16.2)	MEK(14.1)	MEK(3.3)	MEK(0.5)	MEK(3.4)	MEK(1.4)
SER								
60mJ/cmZ對光時	12	8	18	13	19	13	23	17
旭27ステップ・ナブレット段数								
・テンティング性			1					
(≥)	. 3	3	3	3	3	3	3	3
	<u> </u>	[<u> </u>	L.,	l		<u> </u>	L

【表1】

[0038]

[発明の効果]以上説明したように、本発明の新規な光 硬化性樹脂組成物は、2,4,5-トリアリールイミダ ゾリル二量体を含む光硬化性樹脂組成物の特徴である高※ ※いテンティング硬化膜強度を維持し、さらに感度が高く 露光時間が短縮できるため、プリント配線板の製造に極 めて有利に利用することができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁶		證別記 号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
G03F	7/027	502		G03F	7/027	502	
	7/033	•			7/033		
H 0 5 K	3/06			H 0 5 K	3/06	J	
					•	Н	
// H05K	3/18		6921-4E		3/18	D	